17p-E15-10

高均一 GaAs 量子ナノディスクにおけるピコ秒キャリアダイナミクス

Picosecond Carrier Dynamics in Highly Uniform GaAs Quantum Nanodisks

北大院情報科学¹,東北大流体研²,東北大 WPI-AIMR³, JST-CREST⁴

⁰木場 隆之^{1,4}, 田中 亨¹, 田村 洋典^{2,4}, 肥後 昭男³, 寒川 誠二^{2,3,4}, 村山 明宏^{1,4}

Grad. School of IST, Hokkaido Univ.¹, IFS, Tohoku Univ.², WPI-AIMR Tohoku Univ.³, JST-CREST⁴

^oT. Kiba^{1,4}, T. Tanaka¹, Y. Tamura^{2,4}, A. Higo³, S. Samukawa^{2,3,4}, and A. Murayama^{1,4}

E-mail: tkiba@ist.hokudai.ac.jp

【序】III-V 族化合物半導体を用いた量子ドットの高密度集積化は、太陽電池の高効率化やレーザの低消費 電力化を図る上で重要な技術であり、広く研究されている。我々の研究グループでは、従来の自己組織化 (S-K 成長モード)を利用した量子ドットの作製技術とは異なり、バイオテンプレートと低損傷中性粒子ビームエ ッチングを組み合わせて、直径 20 nm 以下の Si や GaAs のナノディスク(ND)からなる量子ドット配列をトップダ ウン加工で作製し、強い発光を観測している[1-3]。本手法で作製された ND は、形状が等方的であり、Wetting Layer が存在しないという点において、従来の S-K 成長による自己組織化量子ドットとは異なる特徴を有してお り、光励起キャリアのダイナミクスに対する影響に興味がもたれる。今回は、挟線幅のフォトルミネッセンス(PL) が確認された高均一な GaAs ND について時間分解 PL 分光を行い、ピコ~ナノ秒の時間領域におけるキャリ アダイナミクスと量子効果の影響について研究した。

【実験】 有機金属気相成長法により成長した 4 nm, 8 nm 厚の GaAs/Al_{0.15}Ga_{0.85}As 量子井戸の表面に鉄内包 タンパク質(PEG 修飾フェリチン)を配列させ、その鉄コアをバイオテンプレートとした中性粒子ビームエッチング により、平均直径 15 nm、ディスク密度 5×10¹⁰ cm⁻²の GaAs ND を作製した。その後 AlGaAs の埋め込み再成 長を行った。フェムト秒チタンサファイアレーザの第 2 高調波(波長 400 nm)によりサンプルを励起し、その PLを ストリークカメラで時間分解検出した。

【結果・考察】Fig.1に8nm厚のGaAsNDについて、6Kで測定したPLスペクトルの励起パワー依存性を示 す。低パワー(0.2 mW)でのPLスペクトルは767 nmにピークを持ち左右対称の形状をしているが、パワーの増 大とともにPLスペクトルは高エネルギー側に拡がってゆく。このことから、パワーの増大とともにNDの高励起準 位からの発光成分が含まれていることが示唆される。Fig.2に、GaAsNDの基底準位(1.61 eV)に対応したPL 減衰特性の励起パワー依存性を示す。0.2 mW 励起では、立ち上がり成分(70 ps)は含むものの、その後単一 指数関数的に減衰している。一方 2 mW, 20 mW 励起では、光励起後 400 ps 程度まで PL 強度の減衰が始ま らず、その後減衰を始めており、基底準位に対するフィリングが生じている事を示している。PL 減衰特性の励 起パワーや温度依存性について、バリアからのキャリア注入とNDにおける量子準位のフィリング効果を含めた レート方程式解析を行い、GaAsNDにおけるキャリアダイナミクスを明らかにする。

[1] T. Kiba et al., Appl. Phys. Lett. 100, 053117 (2012).

[2] T. Kaizu et al., Appl. Phys. Lett. 101, 113108 (2012).

[3] Y. Tamura et al., Nanotechnology 24, 285301 (2013).





Fig. 1 Excitation-power dependence of time-integrated PL spectrum of 8 nm $GaAs/Al_{0.15}Ga_{0.85}As$ NDs at 6 K. Red circles indicate three dimensional calculations of interband-transition energies for 8 nm-thick, 15 nm-diameter GaAs ND.

Fig. 2 PL time-profiles of GaAs NDs with the spectral window of 767-773 nm (shaded area in Fig.1) as a function of excitation power